



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种利用电化学共沉积制备镍/钛硅铝碳复合涂层的方法

文献类型：专利

作者 周延春 and 梁莹

发表日期 2012-02-08

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及可加工层状钛硅铝碳陶瓷领域,特别提供了一种利用电化学共沉积制备镍/钛硅铝碳复合涂层的方法,避免镍基体与钛硅铝碳之间发生相互扩散或反应等问题。在含有硫酸镍、氯化镍和硼酸的镀镍液中,添加钛硅铝碳粉末使之在镀液中充分悬浮,在镍离子阴极还原的同时,将固体颗粒吸附或包覆与金属共沉积制备复合涂层。镀液中硫酸镍的浓度为240-300g/L,氯化镍的浓度为45-75g/L,硼酸的浓度为37-53g/L,钛硅铝碳的固相含量为2-60g/L,pH值范围为3.5-5.0,温度为49-61°C,电沉积时镀液处于搅拌状态,搅拌速率为200-600rpm,电流密度为20-80mA/cm²,沉积时间为15-60mi...

公开日期 2012-02-08

语种 中文

专利申请号 CN102345144A

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/67204>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 周延春 and 梁莹. 一种利用电化学共沉积制备镍/钛硅铝碳复合涂层的方法. 2012-02-08.

GB/T 7714

入库方式：OAI收割

来源：[金属研究所](#)

浏览

84

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。